

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>  
H01L 21/304

(11) 공개번호 특1997-0052685  
(43) 공개일자 1997년07월29일

(21) 출원번호	특1995-0062040
(22) 출원일자	1995년12월28일
(71) 출원인	삼성전자 주식회사 김광호
(72) 발명자	경기도 수원시 팔달구 매탄동 416번지 송화수 인천광역시 연수구 옥련동 348-101번지 한샘빌라 4동 302호

**심사청구 : 없음**

**(54) 오염방지용 차폐판을 설치한 소스반응실**

**요약**

이 발명은 이온소스 반응실의 오염실을 방지하기 위하여 차폐판을 소스반응실(Source Chamber)내부에 설치한 오염방지용 차폐판을 설치한 소스반응실(Source Chamber)에 관한 것이다.

이 발명의 구성은, 이온빔을 생성하는 소스반응실 본체; 소스반응실 본체의내부에 설치되어, 소스반응실 본체의 내부의 오염을 방지하는 차폐판; 생성된 이온소스를 방출하는 이온소스 헤드로 이루어진다.

이 발명의 효과는, 세정시간 및 소스반응실(Source Chamber)의 아웃개싱 시간을 감소시킬 수 있어서 대기압 상태에서 고진공 상태로 만드는 소요시간을 크게 줄여서 이온주입 공정의 생산성을 향상시킬 수 있는 오염방지용 차폐판을 설치한 소스반응실(Source Chamber)을 제공할 수 있다.

**대표도**

**도2**

**명세서**

[발명의 명칭]

오염방지용 차폐판을 설치한 소스반응실

[도면의 간단한 설명]

제2도는 이 발명의 실시예에 따른 오염방지용 차폐판을 설치한 소스반응실의 구조도

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

**(57) 청구의 범위**

**청구항 1**

소스반응실에 있어서, 이온빔을 생성하는 소스반응실 본체; 소스반응실 본체의내부에 설치되어, 소스반응실 본체의 내부의 오염을 방지하는 차폐판; 생성된 이온소스를 방출하는 이온소스 헤드로 이루어진 것을 특징으로 하는 오염방지용 차폐판을 설치한 소스반응실.

**청구항 2**

제1항에 있어서, 상기의 차폐판은, 다수의 차폐판들을 결합하는 것을 특징으로 하는 오염방지용 차폐판을 설치한 소스반응실.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

**도면**

도면2

